

488696-2026 - Procedura konkurencyjna

Irlandia – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) – LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

OJ S 134/2026 15/07/2026

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy - Ogłoszenie o zmianie Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Education Procurement Service (EPS)

E-mail: info@educationprocurementservice.ie

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

Opis: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Identyfikator procedury: a024c275-b92f-48d9-83b8-52aa370660c8

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): South-East (IE052)

Kraj: Irlandia

2.1.3. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 3 300 000,00 EUR

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.5. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które jeden oferent może składać oferty: 4

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Plasma Etcher ,Silicon ,Dielectrics

Opis: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Wewnętrzny identyfikator: 1

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): South-East (IE052)

Kraj: Irlandia

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 48 Miesiące

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Cel zamówienia strategicznego: Zamówienia inne niż strategiczne

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: angielski

Języki, w których dokumenty zamówienia (lub ich części) są nieoficjalnie dostępne: angielski

Termin występowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: angielski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Dozwolone

Termin składania ofert: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 180 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Miejsce: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego:

Jeszcze nie wiadomo

Fakturowanie elektroniczne: Wymagane

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: nie

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: The High Court of Ireland

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Education Procurement Service (EPS)

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: The High Court of Ireland

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Education Procurement Service (EPS)

Organizacja rozpatrująca oferty: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: Plasma Etcher ,Metals ,Piezoelectrics

Opis: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Wewnętrzny identyfikator: 2

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): South-East (IE052)

Kraj: Irlandia

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 48 Miesiące

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Cel zamówienia strategicznego: Zamówienia inne niż strategiczne

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: angielski

Języki, w których dokumenty zamówienia (lub ich części) są nieoficjalnie dostępne: angielski

Termin występowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: angielski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Dozwolone

Termin składania ofert: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 180 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Miejsce: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Jeszcze nie wiadomo

Fakturowanie elektroniczne: Wymagane

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: nie

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: The High Court of Ireland

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Education Procurement Service (EPS)

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: The High Court of Ireland

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Education Procurement Service (EPS)

Organizacja rozpatrująca oferty: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Część zamówienia: LOT-0003

Tytuł: Plasma Etcher ,Slow and Controllable Rate ,Atomic Layer Etch for Silicon , Dielectrics

Opis: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Wewnętrzny identyfikator: 3

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): South-East (IE052)

Kraj: Irlandia

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 48 Miesiące

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Cel zamówienia strategicznego: Zamówienia inne niż strategiczne

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: angielski

Języki, w których dokumenty zamówienia (lub ich części) są nieoficjalnie dostępne: angielski

Termin występowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: angielski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Dozwolone

Termin składania ofert: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 180 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Miejsce: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Jeszcze nie wiadomo

Fakturowanie elektroniczne: Wymagane

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: nie

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: The High Court of Ireland

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Education Procurement Service (EPS)

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: The High Court of Ireland

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Education Procurement Service (EPS)

Organizacja rozpatrująca oferty: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Część zamówienia: LOT-0004

Tytuł: Plasma Deposition ,PECVD

Opis: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Wewnętrzny identyfikator: 4

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): South-East (IE052)

Kraj: Irlandia

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 48 Miesiące

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Cel zamówienia strategicznego: Zamówienia inne niż strategiczne

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: angielski

Języki, w których dokumenty zamówienia (lub ich części) są nieoficjalnie dostępne: angielski

Termin występowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: angielski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Dozwolone

Termin składania ofert: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 180 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Miejsce: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Jeszcze nie wiadomo

Fakturowanie elektroniczne: Wymagane

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: nie

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: The High Court of Ireland

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Education Procurement Service (EPS)

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: The High Court of Ireland

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Education Procurement Service (EPS)

Organizacja rozpatrująca oferty: Education Procurement Service (EPS)

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Education Procurement Service (EPS)

Numer rejestracyjny: IE 6609370 G

Adres pocztowy: Castletroy Limerick

Miejscowość: Limerick

Kod pocztowy: V94 DK53

Podpodział krajowy (NUTS): Mid-West (IE051)

Kraj: Irlandia

E-mail: info@educationprocurementservice.ie

Telefon: 000

Adres strony internetowej: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Profil nabywcy: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Organizacja rozpatrująca oferty

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: The High Court of Ireland

Numer rejestracyjny: The High Court of Ireland

Departament: The High Court of Ireland

Adres pocztowy: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7

Miejscowość: Dublin

Kod pocztowy: D07 WDX8

Podpodział krajowy (NUTS): Dublin (IE061)

Kraj: Irlandia

E-mail: HighCourtCentralOffice@courts.ie

Telefon: +353 1 8886000

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: European Dynamics S.A.

Numer rejestracyjny: 002024901000

Departament: European Dynamics S.A.

Miejscowość: Athens

Kod pocztowy: 15125

Podpodział krajowy (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)

Kraj: Grecja

E-mail: eproc-esender@eurodyn.com

Telefon: +30 2108094500

Role tej organizacji:

10. Zmiana

Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana

:

46fee6a2-f409-4cd6-80db-618a50fcc925-01

Główny powód zmiany

:

Aktualizacja informacji

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 7a2067c1-5ebe-49f4-b53b-0f9595ac5fa3 - 02

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 13/07/2026 16:03:29 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski,
czas zachodnioeuropejski letni

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: angielski

Numer publikacji ogłoszenia: 488696-2026

Numer wydania Dz.U. S: 134/2026

Data publikacji: 15/07/2026